## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## ! [84] | BINDO | 1 | BINDO | B

(43) 国際公開日 2005年5月12日(12.05.2005)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 2005/043248 A1

(51) 国際特許分類?:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016129

(22) 国際出願日:

2004年10月29日(29.10.2004)

G03F 7/11, H01L 21/027

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-370354

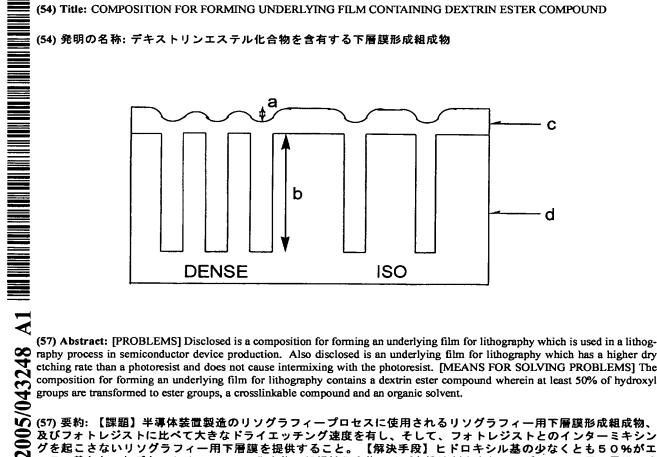
2003年10月30日(30.10.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日産化 学工業株式会社 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒1010054 東京都千代田区神田錦町 3 丁 目 7 番地 1 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹井 敏 (TAKEI, Satoshi) [JP/JP]; 〒9392753 富山県婦負郡婦中町笹倉 635日産化学工業株式会社富山研究開発センター 内 Toyama (JP). 境田 康志 (SAKAIDA, Yasushi) [JP/JP]; 〒9392753 富山県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学 工業株式会社富山研究開発センター内 Toyama (JP). 新城 徹也 (SHINJO, Tetsuya) [JP/JP]; 〒9392753 富山 県婦負郡婦中町笹倉635 日産化学工業株式会社富 山研究開発センター内 Toyama (JP).
- (74) 代理人: 萼経夫,外(HANABUSA, Tsuneo et al.); 〒 1010062 東京都千代田区神田駿河台 3 丁目 2 番地 新 御茶ノ水アーパントリニティ 萼特許事務所内 Tokyo (JP).

/続葉有/

- (54) Title: COMPOSITION FOR FORMING UNDERLYING FILM CONTAINING DEXTRIN ESTER COMPOUND



(57) Abstract: [PROBLEMS] Disclosed is a composition for forming an underlying film for lithography which is used in a lithography process in semiconductor device production. Also disclosed is an underlying film for lithography which has a higher dry etching rate than a photoresist and does not cause intermixing with the photoresist. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] The composition for forming an underlying film for lithography contains a dextrin ester compound wherein at least 50% of hydroxyl

及びフォトレジストに比べて大きなドライエッチング速度を有し、そして、フォトレジストとのインターミキシン グを起こさないリソグラフィー用下層膜を提供すること。 【解決手段】ヒドロキシル基の少なくとも50%がエ ステル基となったデキストリンエステル化合物、架橋性化合物、及び有機溶剤を含むリソグラフィー用下層膜形成 組成物。

**0**M

- (81) 指定国 / 表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists -\Box \gamma \land f$  (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

## -- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。